

光谱学与光谱分析 2006 26 (12): 2360-2363 ISSN: 1000-0593 CN: 11-2200/O4 [首页](#)  
[当期目录](#) [上一期](#) [下一期](#)

光谱学与光谱分析

### 光助Fenton试剂氧化降解染料直接耐晒黑G的研究

郑怀礼<sup>1, 2</sup>, 刘宏<sup>1</sup>, 李方<sup>3</sup>, 黄玉明<sup>4</sup>

1. 重庆大学化学化工学院, 重庆 400044
2. 重庆大学三峡库区生态环境教育部重点实验室, 重庆 400045
3. 四川大学化学科学学院, 四川 成都 610064
4. 西南师范大学化学化工学院, 重庆 400715

收稿日期 2005-11-10 修回日期 2006-3-25 网络版发布日期 2006-12-26

**摘要** 文章研究了影响Fenton试剂氧化降解持久性有机污染物直接耐晒黑G的因素, 如光源的选择、初始pH值、H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>的用量、Fe<sup>2+</sup>的用量、阳离子交换树脂载体的引入等, 通过研究确定了各因素的优化条件。研究表明: 太阳光照能有效的促进直接耐晒黑G染料的降解脱色, 大大缩短反应时间; 引入阳离子交换树脂后, 可增强Fenton氧化反应的活性, 降解效果更好。

**关键词** 光助Fenton试剂 直接耐晒黑G 持久性有机污染物 降解 脱色

**分类号** O643

**DOI:**

**通讯作者:**

郑怀礼

### 扩展功能

#### 本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(483KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

#### 服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)

#### 相关信息

- ▶ [本刊中 包含“光助Fenton试剂”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
  - [郑怀礼](#)
  - [刘宏](#)
  - [李方](#)
  - [黄玉明](#)

